

NMFS2023 2nd Nano-Micro Fabrication Symposium

半導体加工技術を応用して微細パターンを形成するナノマイクロファブ리케이션は、半導体のみならずセンサや微小光学部品などの幅広いデバイス作製に欠かせない技術です。その要であるリソグラフィ技術のほか、エッチング、成膜、インプリント、めっきなど、様々な技術が複合的に用いられますが、加工装置や計測装置の進歩により、その応用範囲が拡大しています。本シンポジウムでは、デバイス分野の研究開発を加速させることを目的として、最新の加工装置や計測装置で可能となるナノマイクロファブ리케이션に関するショートプレゼンとハンズオンの実習を行います。

- <日程> 2023年11月22日(水)
<主催> Nano-Micro Fabrication Symposium実行委員会
<共催> 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター、MEMSパークコンソーシアム
<会場> 東北大学西澤潤一記念研究センター
<参加費> 無料

■お問い合わせ・ハンズオン実習申込先：NMFS実行委員会事務局
nmfs-office@mail.mu-sic.tohoku.ac.jp) TEL:022-229-4113

東北大学試作コインランドリで利用可能なツールを中心に、メーカー各社の協力により、ショートプレゼンとハンズオンの実習を行います。
最新の加工技術を知って体験できる場です。前日のフラウンホーファシンポジウムに引き続き、ぜひご参加ください。

〈プログラム〉

- 10:00-12:00 ショートプレゼン（無料、事前参加申込不要）
- 10:00-10:15 GenlSys
10:15-10:30 エリオニクス
10:30-10:45 ハイデルベルク・インストルメンツ
- 11:00-11:15 SIJテクノロジー
11:15-11:30 住友精密工業
11:30-11:45 TOWAレーザーフロント
- 12:00-13:00 昼食交流会（お一人様 1,000円）
- 13:00-17:00 ハンズオン実習（無料、事前参加申込必要）

- コース1 サブフェムトインクジェットパターンニングコース（SIJテクノロジー）
コース2 EBリソグラフィコース（GenlSys、エリオニクス）
近接効果補正(OPC)、フィールドつなぎ補正
コース3 グレイスケール、パターン補正を含む精密リソグラフィコース
（GenlSys、ミカサ、ハイデルベルグ・インストルメンツ）
試作パターン：回折光学素子(DOE)、フレネルレンズ、近接効果補正(OPC)